

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成30年9月13日 (2018.9.13)

【公開番号】特開2017-112234(P2017-112234A)

【公開日】平成29年6月22日 (2017.6.22)

【年通号数】公開・登録公報2017-023

【出願番号】特願2015-245747(P2015-245747)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/312 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

C 0 8 F 220/56 (2006.01)

H 0 1 B 3/44 (2006.01)

H 0 1 B 17/56 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/312 A

H 0 1 L 29/78 6 1 7 T

C 0 8 F 220/56

H 0 1 B 3/44 Z

H 0 1 B 17/56 L

【手続補正書】

【提出日】平成30年8月6日 (2018.8.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 4】

共重合体 (A) 中、 $\text{—CH=CH—}$  - 不飽和化合物 (a 1) 由来のアミド基のモル数 (X) と、活性水素基を有する  $\text{—CH=CH—}$  - 不飽和化合物 (a 2 - 1) 由来の活性水素基のモル数 (Y) との当量比 (X) / (Y) が、1 以上であることを特徴とする請求項 2 または 3 に記載の絶縁膜形成用組成物。